# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-034582

(43) Date of publication of application: 07.02,2003

(51)Int.CI.

CO4B 35/622 B09B 3/00 CO4B 35/00 CO4B 35/495 CO4B 35/626

(21)Application number : 2001-221302

(71)Applicant: TAIYO YUDEN CO LTD

(22)Date of filing:

23.07.2001

(72)Inventor: SASAKI NOBUHIRO

KATO SADAYOSHI

MATSUSHITA KUNIHIRO TOSHIRO MAKOTO KIKUCHI HITOSHI

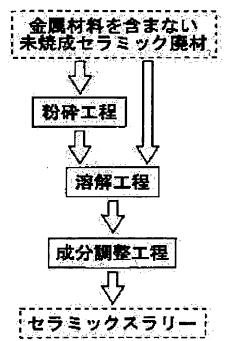
**ITOI HAJIME** 

(54) RECLAIMED CERAMIC SLURRY AND ITS PRODUCTION METHOD, RECLAIMED CERAMIC POWDER AND ITS PRODUCTION METHOD, AND CERAMIC ELECTRONIC PART AND ITS PRODUCTION METHOD

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a reclaimed ceramic slurry capable of contributing to the reduction of the cost required for waste disposal, and to the reduction of the cost for producing ceramic electronic parts.

SOLUTION: When obtaining the reclaimed ceramic slurry from unburned ceramic wastes containing no metal, the unburned ceramic wastes are first dissolved in solvent (dissolution step), and then after the dissolution step. the components of the waste solution are adjusted (component adjusting step). Although the waste solution already contains ceramic particles, binders, plasticizers, dispersants and solvents, the materials other than the ceramic particles are added to adjust the components so that each component has each predetermined concentration.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

26.05.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]
[Patent number]
[Date of registration]
[Number of appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-34582

(P2003-34582A)

(43)公開日 平成15年2月7日(2003.2.7)

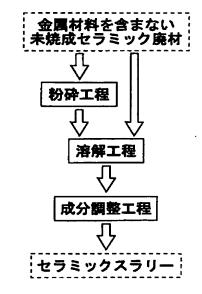
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマコート*(参考)		
C 0 4 B	35/622		C 0 4 B	35/00		D	4D004	
B09B	3/00					Α	4G030	
		ZAB				V		
C 0 4 B	35/00					· J		
	35/495		B09B	3/00		304J		
		<b>朱龍査審</b>	未請求 請求	項の数19	OL	(全 12 頁)	最終頁に続く	
(21)出顧番号 特顯2001-221302(P2001-221302)		(71) 出願人	0002042	84				
				太陽鬱電	献式	会社		
(22)出顧日		平成13年7月23日(2001.7.23) 東京都台東区上野6丁目16番20号						
			(72)発明者	佐々木	信弘			
				東京都台	20東台	上野6丁目16	番20号 太陽誘	
		•		電株式会	会社内			
			(72)発明者	<b>「加藤」</b>	〔佳			
						上野6丁目16	番20号 太陽誘	
				電株式会	会社内			
•			(74)代理人	1000699	81			
				弁理士	吉田	精孝 (外	1名)	
							最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 再生セラミックスラリー及びその製造方法と、再生セラミック粉末及びその製造方法と、セラミック電子部品及びその製造方法

## (57)【要約】

【課題】 廃材処分に要するコスト負担の軽減及びセラミック電子部品の製造コストの低減等に貢献できる、再生セラミックスラリーを提供する。

【解決手段】 金属材料を含まない未焼成セラミック廃材から再生セラミックスラリーを得るときには、まず、溶剤により未焼成セラミック廃材の溶解(溶解工程)を行い、溶解工程後は、次に、廃材溶液の成分調整(成分調整工程)を行う。前記の廃材溶液には、セラミック粒子とバインダーと可塑剤と分散剤と溶剤等が既に含まれているが、ここでは各々が所定の配合割合となるようにセラミック粒子以外の材料を添加してその成分調整を行う。



(2)

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 金属材料を含まない未焼成セラミック廃 材を溶剤により溶解し、廃材溶液の成分を調整すること により生成された、

1

ことを特徴とする再生セラミックスラリー。

【請求項2】 金属材料を含まない未焼成セラミック廃 材を溶剤により溶解する工程と、

廃材溶液の成分を調整してセラミックスラリーを生成す る工程とを備える、

ことを特徴とする再生セラミックスラリーの製造方法。 【請求項3】 金属材料を含む未焼成セラミック廃材を 溶剤により溶解し、廃材溶液から金属を除去し、金属が 除去された廃材溶液の成分を調整することにより生成さ れた、

ことを特徴とする再生セラミックスラリー。

【請求項4】 金属材料を含む未焼成セラミック廃材を 溶剤により溶解する工程と、

廃材溶液から金属を除去する工程と、

金属が除去された廃材溶液の成分を調整してセラミック スラリーを生成する工程とを備える、

ことを特徴とする再生セラミックスラリーの製造方法。

【請求項5】 金属材料を含まない未焼成セラミック廃 材を溶剤により溶解し、廃材溶液からバインダーを除去 し、バインダーが除去された廃材溶液を粉末化すること により生成された、

ことを特徴とする再生セラミック粉末。

【請求項6】 金属材料を含まない未焼成セラミック廃 材を溶剤により溶解する工程と、

廃材溶液からバインダーを除去する工程と、

ク粉末を生成する工程とを備える、

ことを特徴とする再生セラミック粉末の製造方法。

【請求項7】 金属材料を含まない未焼成セラミック廃 材からバインダーを除去し、バインダーが除去された未 焼成セラミック廃材を粉末化することにより生成され た、

ことを特徴とする再生セラミック粉末。

【請求項8】 金属材料を含まない未焼成セラミック廃 材からバインダーを除去する工程と、

バインダーが除去された未焼成セラミック廃材を粉末化 40 い未焼成セラミック廃材からバインダーを除去し、バイ してセラミック粉末を生成する工程とを備える、

ことを特徴とする再生セラミック粉末の製造方法。

【請求項9】 金属材料を含む未焼成セラミック廃材を 溶剤により溶解し、廃材溶液から金属を除去し、廃材溶 液からバインダーを除去し、金属及びバインダーが除去 された廃材溶液を粉末化することにより生成された、 ことを特徴とする再生セラミック粉末。

【請求項10】 金属材料を含む未焼成セラミック廃材 を溶剤により溶解する工程と、

廃材溶液から金属を除去する工程と、

廃材溶液からバインダーを除去する工程と、

金属及びバインダーが除去された廃材溶液を粉末化して セラミック粉末を生成する工程とを備える、

ことを特徴とする再生セラミック粉末の製造方法。

【請求項11】 未焼成セラミック廃材を再生して得た セラミックスラリーを用いて製造された。

ことを特徴とするセラミック電子部品

【請求項12】 未焼成セラミック廃材を再生して得た セラミックスラリーを用いてグリーンシートを形成する 10 工程を備える、

ことを特徴とするセラミック電子部品の製造方法。

【請求項13】 セラミックスラリーは、金属材料を含 まない未焼成セラミック廃材を溶剤により溶解し、廃材 溶液の成分を調整することにより生成されたものであ

ことを特徴とする請求項12に記載のセラミック電子部 品の製造方法。

【請求項14】 セラミックスラリーは、金属材料を含 む未焼成セラミック廃材を溶剤により溶解し、廃材溶液 20 から金属を除去し、金属が除去された廃材溶液の成分を 調整することにより生成されたものである、

ことを特徴とする請求項12に記載のセラミック電子部 品の製造方法。

【請求項15】 未焼成セラミック廃材を再生して得た セラミック粉末を用いて製造された、

**ととを特徴とするセラミック電子部品** 

【請求項16】 未焼成セラミック廃材を再生して得た **´セラミック粉末を用いてセラミックスラリーを形成する** 工程と、

バインダーが除去された廃材溶液を粉末化してセラミッ 30 とのセラミックスラリーを用いてグリーンシートを形成 する工程とを備える、

ことを特徴とするセラミック電子部品の製造方法。

【請求項17】 セラミック粉末は、金属材料を含まな い未焼成セラミック廃材を溶剤により溶解し、廃材溶液 からバインダーを除去し、バインダーが除去された廃材 溶液を粉末化することにより生成されたものである、

ことを特徴とする請求項16に記載のセラミック電子部 品の製造方法。

【請求項18】 セラミック粉末は、金属材料を含まな ンダーが除去された未焼成セラミック廃材を粉末化する ととにより生成されたものである、

ことを特徴とする請求項16に記載のセラミック電子部 品の製造方法。

【請求項19】 セラミック粉末は、金属材料を含む未 焼成セラミック廃材を溶剤により溶解し、廃材溶液から 金属を除去し、廃材溶液からバインダーを除去し、金属 及びバインダーが除去された廃材溶液を粉末化すること により生成されたものである、

50 ことを特徴とする請求項16に記載のセラミック電子部

3

品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、再生セラミックス ラリー及びその製造方法と、再生セラミック粉末及びそ の製造方法と、セラミック電子部品及びその製造方法に 関する。

[0002]

【従来の技術】セラミック電子部品の1つとして知られ る積層セラミックコンデンサには同時焼成タイプのもの 10 と非同時焼成タイプのものとがあり、同時焼成タイプの ものは、帯状フィルムの上にセラミックスラリーを塗工 してグリーンシートを作成する工程、グリーンシート上 に導体ペーストを印刷して所定配列の内部電極用導体層 を形成する工程、グリーンシートを単位寸法で打ち抜き これを積層して圧着する工程、圧着シートをダイサーや スライサー等の装置によってチップサイズに分断する工 程、各未焼成チップからバインダーを除去する工程、各 未焼成チップの表面に導体ペーストを塗布して外部電極 用導体層を形成する工程、各未焼成チップを内部電極用 20 の未焼成導体層及び外部電極用の未焼成導体層と一緒に 焼成する工程、外部電極の表面に1以上のメッキ層を形 成する工程とを経て製造されている。また、非同時焼成 タイプのものは、前記脱バインダー工程の後に各未焼成 チップを内部電極用の未焼成導体層と一緒に焼成した後 に、各焼成チップの表面に導体ペーストを塗布して外部 電極用導体層を形成しこれを焼成して外部電極を形成し ている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】先に述べたように積層 30 セラミックコンデンサを製造する過程では種々の未焼成 セラミック廃材が発生する。例えば、前記のグリーンシ ート形成工程では、厚み不良、密度不良、しわ残存、ビ ンホール有り等の不良を生じたグリーンシートが未焼成 セラミック廃材となる。また、前記の積層・圧着工程で は、打ち抜き後のグリーンシート残骸が未焼成セラミッ ク廃材となると共に、積層不良、圧着不良等の不良を生 じた圧着シートが未焼成セラミック廃材となる。さら に、前記の分断工程では、カット不良等の不良を生じた 未焼成チップが未焼成セラミック廃材となると共に、カ 40 ット後の圧着シート残骸やスラッジ(削りくず)が未焼 成セラミック廃材となる。

【0004】勿論、積層セラミックコンデンサに限ら ず、前記と同じ或いは近似の工程を利用して製造される 他種のセラミック電子部品においても前記同様の未焼成 セラミック廃材がその製造過程で発生する。

【0005】前記の未焼成セラミック廃材は製造側の責 任において適正に処分されているが、近年におけるセラ ミック電子部品の需要増加に伴って前記の未焼成セラミ ック廃材は増加傾向にあることからその処分に要するコ 50 ック廃材を粉末化することにより生成されたことを特徴

スト負担は極めて大きく、同コスト負担が製造コストの 低減を図る際の隘路となっている。つまり、セラミック 電子部品の製造過程で生じた未焼成セラミック廃材を再 生して利用できるようにすれば、前記の廃材処分に要す るコスト負担を軽減できると共にセラミック電子部品の 製造コストの低減等を図ることができる。

【0006】本発明は前記事情に鑑みて創作されたもの で、その目的とするところは、廃材処分に要するコスト 負担の軽減及びセラミック電子部品の製造コストの低減 等に貢献できる、再生セラミックスラリー及びその製造 方法と、再生セラミック粉末及びその製造方法と、セラ ミック電子部品及びその製造方法を提供することにあ

[0007]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明に係る再生セラミックスラリーは、金属材料 を含まない未焼成セラミック廃材を溶剤により溶解し、 廃材溶液の成分を調整することにより生成されたことを 特徴とし、その製造方法は、金属材料を含まない未焼成 セラミック廃材を溶剤により溶解する工程と、廃材溶液 の成分を調整してセラミックスラリーを生成する工程と を備えることを特徴とする。この再生セラミックスラリ ーはセラミック電子部品を製造する際の材料として非再 生のものと同様に用いることができる。

【0008】また、本発明に係る再生セラミックスラリ ーは、金属材料を含む未焼成セラミック廃材を溶剤によ り溶解し、廃材溶液から金属を除去し、金属が除去され た廃材溶液の成分を調整することにより生成されたこと を特徴とし、その製造方法は、金属材料を含む未焼成セ ラミック廃材を溶剤により溶解する工程と、廃材溶液か ら金属を除去する工程と、金属が除去された廃材溶液の 成分を調整してセラミックスラリーを生成する工程とを 備えることを特徴とする。この再生セラミックスラリー はセラミック電子部品を製造する際の材料として非再生 のものと同様に用いることができる。

【0009】一方、本発明に係る再生セラミック粉末 は、金属材料を含まない未焼成セラミック廃材を溶剤に より溶解し、廃材溶液からバインダーを除去し、バイン ダーが除去された廃材溶液を粉末化することにより生成 されたことを特徴とし、その製造方法は、金属材料を含 まない未焼成セラミック廃材を溶剤により溶解する工程 と、廃材溶液からバインダーを除去する工程と、バイン ダーが除去された廃材溶液を粉末化してセラミック粉末 を生成する工程とを備えることを特徴とする。この再生 セラミック粉末はセラミック電子部品を製造する際の材 料として非再生のものと同様に用いることができる。

【0010】また、本発明に係る再生セラミック粉末 は、金属材料を含まない未焼成セラミック廃材からバイ ンダーを除去し、バインダーが除去された未焼成セラミ とし、その製造方法は、金属材料を含まない未焼成セラ ミック廃材からパインダーを除去する工程と、パインダ ーが除去された未焼成セラミック廃材を粉末化してセラ ミック粉末を生成する工程とを備えることを特徴とす る。この再生セラミック粉末はセラミック電子部品を製 造する際の材料として非再生のものと同様に用いること ができる。

【0011】さらに、本発明に係る再生セラミック粉末 は、金属材料を含む未焼成セラミック廃材を溶剤により 溶解し、廃材溶液から金属を除去し、廃材溶液からバイ 10 ンダーを除去し、金属及びバインダーが除去された廃材 溶液を粉末化することにより生成されたことを特徴と し、その製造方法は、金属材料を含む未焼成セラミック 廃材を溶剤により溶解する工程と、廃材溶液から金属を 除去する工程と、廃材溶液からパインダーを除去する工 程と、金属及びパインダーが除去された廃材溶液を粉末 化してセラミック粉末を生成する工程とを備えることを 特徴とする。この再生セラミック粉末はセラミック電子 部品を製造する際の材料として非再生のものと同様に用 いるととができる。

【0012】他方、本発明に係るセラミック電子部品 は、未焼成セラミック廃材を再生して得たセラミックス ラリーを用いて製造されたことを特徴とし、その製造方 法は、未焼成セラミック廃材を再生して得たセラミック スラリーを用いてグリーンシートを形成する工程を備え ることを特徴とする。セラミック電子部品の製造過程で 生じた未焼成セラミック廃材を再生して利用できるの で、廃材処分に要するコスト負担を軽減できると共にセ ラミック電子部品の製造コストの低減等を図ることがで きる。

【0013】また、本発明に係るセラミック電子部品 は、未焼成セラミック廃材を再生して得たセラミック粉 末を用いて製造されたことを特徴とし、その製造方法 は、未焼成セラミック廃材を再生して得たセラミック粉 末を用いてセラミックスラリーを形成する工程と、この セラミックスラリーを用いてグリーンシートを形成する 工程とを備えることを特徴とする。セラミック電子部品 の製造過程で生じた未焼成セラミック廃材を再生して利 用できるので、廃材処分に要するコスト負担を軽減でき ることができる。

【0014】本発明の前記目的とそれ以外の目的と、構 成特徴と、作用効果は、以下の説明と添付図面によって 明らかとなる。

### [0015]

【発明の実施の形態】セラミック電子部品の製造過程、 例えば先に述べたような積層セラミックコンデンサの製 造する過程では種々の未焼成セラミック廃材が発生す る。例えば、前記のグリーンシート形成工程では、厚み

生じたグリーンシートが未焼成セラミック廃材となる。 また、前記の積層・圧着工程では、打ち抜き後のグリー ンシート残骸が未焼成セラミック廃材となると共に、積 層不良、圧着不良等の不良を生じた圧着シートが未焼成 セラミック廃材となる。さらに、前記の分断工程では、 カット不良等の不良を生じた未焼成チップが未焼成セラ ミック廃材となると共に、カット後の圧着シート残骸や スラッジ(削りくず)が未焼成セラミック廃材となる。 【0016】前記の未焼成セラミック廃材には金属材 料、即ち未焼成の内部電極用導体層や外部電極用導体層 やとれらの破片を含むものも存在するが、金属材料の有 無に拘わらず未焼成セラミック廃材からは基本的にはそ の主たる含有成分を再生材料として得ることが可能であ

【0017】図1~図4は未焼成セラミック廃材を再生 する場合の処理手順をそれぞれ示すもので、図1に示す 処理手順によれば、金属材料を含まない未焼成セラミッ ク廃材からセラミックスラリーを得ることができる。ま た、図2に示す処理手順によれば、金属材料を含む未焼 20 成セラミック廃材からセラミックスラリーを得ることが でき、その途中過程で金属を得ることも可能である。

【0018】一方、図3(A)または図3(B)に示す 処理手順によれば、金属材料を含まない未焼成セラミッ ク廃材からセラミック粉末を得ることができ、その途中 過程でバインダーを得ることも可能である。また、図4 に示す処理手順によれば、金属材料を含む未焼成セラミ ック廃材からセラミック粉末を得ることができ、その途 中過程で金属とバインダーを得ることも可能である。

【0019】以下に、図1~図4のそれぞれに示した再 30 生処理手順について処理装置等を含めて具体的に説明す る。

【0020】 [図1に示した再生処理手順] 金属材料を 含まない未焼成セラミック廃材から再生セラミックスラ リーを得るときには、まず、溶剤により未焼成セラミッ ク廃材の溶解(溶解工程)を行う。

【0021】この溶解工程で使用する溶剤は未焼成セラ ミック廃材に含まれるバインダーの種類に応じて適正に 選定する必要がある。例えば、含有バインダーがポリビ ニルアルコールの場合には、溶剤として水、アルコール ると共にセラミック電子部品の製造コストの低減等を図 40 系等の1種または2種以上の混合物を用いる。また、含 有バインダーがポリビニルブチラールの場合には、溶剤 としてアルコール系、芳香族炭化水素系、ケトン系、エ ステル系等の1種または2種以上の混合物を用いる。さ らに、含有バインダーがポリエチレングリコールの場合 には、溶剤として水、脂肪族ケトン系、アルコール系、 グリコール系等の1種または2種以上の混合物を用い る。さらに、含有バインダーがメチルセルロースの場合 には、溶剤として水、アルコール系、ハロゲン化炭化水 素系、芳香族炭化水素系、カルボン酸系等の1種または 不良、密度不良、しわ残存、ピンホール有り等の不良を 50 2種以上の混合物を用いる。さらに、含有バインダーが (5)

30

カルボキシメチルセルロースの場合には、溶剤として 水、含水有機溶剤系等の1種または2種以上の混合物を 用いる。さらに、含有バインダーがエチルセルロースの 場合には、溶剤としてアルコール系、芳香族炭化水素 系、ケトン系、エステル系、脂環式炭化水素系等の1種 または2種以上の混合物を用いる。さらに、含有バイン ダーがヒドロキシプロピルセルロースの場合には、溶剤 として水、低級アルコール系等の1種または2種以上の 混合物を用いる。さらに、含有バインダーがアクリル系 の場合には、溶剤として水、アルコール系、芳香族炭化 10 水素系、ケトン系、エステル系等の1種または2種以上 の混合物を用いる。さらに、含有バインダーがポリウレ タン系の場合には、溶剤として水、アルコール系、芳香 族炭化水素系、ケトン系、エステル系等の1種または2 種以上の混合物を用いる。

【0022】図5(A)~図5(D)はこの溶解工程で 使用可能な設備をそれぞれ示す。

【0023】図5(A)に示した撹拌装置1は容器1a と撹拌機1 b とを備える。この撹拌装置1は比較的軟質 なグリーンシート廃材等を溶解するのに適しており、溶 20 解に際しては、撹拌機 1 b を回転させながら溶剤中に未 焼成セラミック廃材を徐々に投入する。このときの廃材 溶液WSは固形分が50wt%以上で髙粘度となるのが 望ましく、撹拌機1bの周速度は10m/s以上となる ようにするのが望ましい。また、廃材溶液WSの温度が 高くなり過ぎると溶剤の揮発が多くなり低すぎると溶解 性が落ちるので、廃材溶液WSの温度が40℃前後に保 たれるように適当な加温・冷却機によって温度コントロ ールを行うことが望ましい。

【0024】図5 (B) に示した混練装置2は容器2a と混練機2bとを備える。この混練装置2は比較的硬質 な圧着シート廃材や未焼成チップ廃材等を溶解するのに 適しており、溶解に際しては、混練機2bを回転させな がらごく少量の溶剤中に未焼成セラミック廃材を徐々に 投入しながら混練して粘土様の固まりを作る。この固ま りをさらに混練して均一な固まりとした後、さらに混練 しながら溶剤を徐々に加えていき、粘度がある程度下が ったら撹拌する。粘度が低いと混練が十分にされないの で、混練開始時は可能な限り高粘度の状態(混練機2 b の負荷が最大になる条件)にする。混練に伴う発熱が著 40 しい場合には必要に応じて冷却を行う。

【0025】図5(C)に示した超音波分散装置3は容 器3aと超音波発振器3bと撹拌機3cとを備える。と の超音波分散装置3は比較的軟質なグリーンシート廃材 等を溶解するのに適しており、溶解に際しては、超音波 発振器3bに電圧を印加しながら溶剤中に未焼成セラミ ック廃材を徐々に投入する。固まりがほぐれにくいよう であれば撹拌機3cを回転させる。このときの廃材溶液 WSは固形分が50wt%以上で高粘度となるのが望ま しく、超音波発振器3bとしては出力が100W以上の 50 ましい。

振動子を複数個用いて総出力が1000W以上となるよ うにするのが望ましい。また、廃材溶液WSの温度が高 くなり過ぎると溶剤の揮発が多くなり低すぎると溶解性 が落ちるので、廃材溶液の温度が40°C前後に保たれる よう適当な加温・冷却機によって温度コントロールを行 うことが望ましい。

【0026】図5(D)に示したメディア分散装置4は 容器4aと分散機4bとを備える。このメディア分散装 置4は比較的軟質なグリーンシート廃材等を溶解するの に適しており、溶解に際しては、分散機4 b を回転させ ながら溶剤中に未焼成セラミック廃材を徐々に投入す る。このときの廃材溶液WSは固形分が50wt%以上 で高粘度となるのが望ましい。また、廃材溶液の温度が 高くなり過ぎると溶剤の揮発が多くなり低すぎると溶解 性が落ちるので、廃材溶液WSの温度が40°C前後に保 たれるように適当な加温・冷却機によって温度コントロ ールを行うことが望ましい。

【0027】尚、比較的硬質な圧着シート廃材や未焼成 チップ廃材等の未焼成セラミック廃材を溶解する場合に は、溶解工程の前工程として必要に応じて未焼成セラミ ック廃材の粉砕(粉砕工程)を行う。図6はこの粉砕工 程で使用可能な設備を示すもので、図6に示した粉砕装 置5は容器5aと撹拌機5bと粉砕ローラー5cとを備 える。粉砕に際しては、未焼成セラミック廃材WAを容 器5 a内に投入しながら撹拌機5 b及び粉砕ローラー5 cを回転させ、未焼成セラミック廃材WAの粉砕物W A'を生成する。

【0028】溶解工程後は、次に、廃材溶液の成分調整 (成分調整工程)を行う。前記の廃材溶液には、セラミ ック粒子とバインダーと可塑剤と分散剤と溶剤等が既に 含まれているが、ととでは可塑剤及び分散剤と同種もし くは同様の効果を有するものを添加する。但し、廃材溶 液に添加する量が1wt%を越えると再生セラミックス ラリーを用いて作成されるグリーンシートの強度が低下 する等の問題が生じるため、1 w t %未満の範囲内で添 加するのが望ましい。また、成分調整中は再生セラミッ クスラリーとなる廃材溶液の成分のサンプリングを行 い、再生セラミックスラリーの固形分濃度が45~60 wt%の範囲内となるように成分調整を行う。

【0029】図7(A)と図7(B)はこの成分調整工 程で使用可能な設備をそれぞれ示す。

【0030】図7(A)に示した濃縮装置6は容器6a と撹拌機6 bと図示省略の減圧ポンプとを備える。成分 調整に際しては、容器6a内を減圧下の状態とし、同状 態で撹拌機6aを回転させて容器6a内の廃材溶液WS を撹拌しながら必要材料の投入を行う。廃材溶液WSの 温度が高くなり過ぎると溶剤の揮発が多くなるので、廃 材溶液WSの温度が40℃前後に保たれるように適当な 加温・冷却機によって温度コントロールを行うことが望 10

【0031】図7(B)に示した撹拌装置7は容器7aと撹拌機7bとを備える。成分調整に際しては、撹拌機7bを回転させて容器7a内の廃材溶液WSを撹拌しながら必要材料の投入を行う。廃材溶液WSの温度が高くなり過ぎると溶剤の揮発が多くなるので、廃材溶液WSの温度が40℃前後に保たれるように適当な加温・冷却機によって温度コントロールを行うことが望ましい。

【0032】以上で、金属材料を含まない未焼成セラミック廃材から再生セラミックスラリーを得ることができる

【0033】この再生セラミックスラリーはセラミック 電子部品を製造する際の材料として非再生のものと同様 に用いることができる。例えば、同時焼成タイプの積層 セラミックコンデンサを製造するときには、帯状フィル ムの上に前記の再生セラミックスラリーを塗工してグリ ーンシートを作成することができ、この後は従来と同様 に、グリーンシート上に導体ペーストを印刷して所定配 列の内部電極用導体層を形成する工程、グリーンシート を単位寸法で打ち抜きこれを積層して圧着する工程、圧 着シートをダイサーやスライサー等の装置によってチッ プサイズに分断する工程、各未焼成チップからバインダ ーを除去する工程、各未焼成チップの表面に導体ペース トを塗布して外部電極用導体層を形成する工程、各未焼 成チップを内部電極用の未焼成導体層及び外部電極用の 未焼成導体層と一緒に焼成する工程、外部電極の表面に 1以上のメッキ層を形成する工程を実施して積層セラミ ックコンデンサを製造することができる。また、非同時 焼成タイプの積層セラミックコンデンサを製造するとき には、前記脱バインダー工程の後に各未焼成チップを内 部電極用の未焼成導体層と一緒に焼成した後に、各焼成 30 チップの表面に導体ベーストを塗布して外部電極用導体 層を形成してれを焼成して外部電極を形成すればよい。

【0034】 [図2 に示した再生処理手順] 金属材料を含む未焼成セラミック廃材から再生セラミックスラリーを得るときには、まず、溶剤により未焼成セラミック廃材の溶解(溶解工程)を行い、必要に応じて溶解工程の前段階で未焼成セラミック廃材の粉砕(粉砕工程)を行う。この溶解工程と粉砕工程の内容は図1の再生処理手順で説明したものと同様である。

【0035】溶解工程後は、次に、廃材溶液からの金属除去(金属除去工程)を行う。前記の廃材溶液には、セラミック粒子と金属粒子とバインダーと可塑剤と分散剤と溶剤等が既に含まれているが、ここでは廃材溶液から主として金属粒子を分離して除去する。

【0036】図8(A)~図8(E)はこの金属除去工程で使用可能な設備をそれぞれ示す。

【0037】図8(A)に示した磁気分離装置8は容器 活性剤、水系の場合にはアニオン界面活性剤が適してい8 a と磁石8 b とを備える。この磁気分離装置8は磁性 る。また、気泡を保つために脂肪酸の多価アルコールエを有する金属が使用されている場合に適しており、金属 ステル等の泡安定剤を添加するのが望ましい。また、気除去にしては、廃材溶液WSを容器8 a 内に入れて静置 50 泡発生器 1 1 b の条件としては、空気を 1 L / m i n の

し、廃材溶液WS中の金属粒子を磁石8bに吸着させ、 この後、デカンテーション(上澄みを取ること)により 金属粒子を含まない廃材溶液を排出して回収し、金属粒子含有物も別途回収する。磁石8bとしては廃材溶液W Sに対して磁力が広範囲に及ぶように、例えば5000 ガウス以上の複数の単位磁石をN極とS極が交互に並ぶように配列したもの等を使用する。前記の分離効率は廃 材溶液WSの粘度に影響され、粘度が低いとセラミック 粒子も沈降してしまうため、セラミック粒子の沈降を防止するには廃材溶液WSの固形分を30wt%以上で4 0wt%以下とすることが望ましい。

【0038】図8(B)に示した遠心分離装置9は回転容器9aを備える。金属除去に際しては、廃材溶液WSを回転容器9a内に入れた後、回転容器9aを所定時間回転させて遠心分離を行いセラミック粒子よりも比重の大きな金属粒子を分離して、金属粒子を含まない廃材溶液を排出して回収し、金属粒子含有物も別途回収する。前記の分離効率は廃材溶液WSの粘度と遠心分離時の外周部周速に影響され、粘度が低く外周部周速度が速いとセラミック粒子も分離されてしまうため、セラミック粒子の分離を防止するには廃材溶液WSの固形分を約40wt%にし、外周部周速を約15m/secとすることが望ましい。

【0039】図8(C)に示した沈殿装置10は段違いに配置された複数の容器10aを備える。金属除去に際しては、廃材溶液WSを1番目の容器10a内に入れて静置し、セラミック粒子よりも比重の大きな金属粒子を沈殿させ、そして、1番目の容器10a内の廃材溶液WSの上澄みを2番目の容器10a内に入れて静置し、セラミック粒子よりも比重の大きな金属粒子を沈殿させ、以後も必要回数同作業を繰り返して金属粒子を含まない廃材溶液を排出して回収し、金属粒子含有物も別途回収する。前記の分離効率は廃材溶液WSの粘度に影響し、溶剤含有率が高いと金属粒子と一緒にセラミック粒子も沈降してしまうため、セラミック粒子の沈降を防止するには廃材溶液WSの固形分を30wt%以上とすることが望ましい。

【0040】図8(D)に示した気泡装置11は容器11aと気泡発生器11bとを備える。金属除去に際しては、容器11a内に入れた廃材溶液WSに界面活性剤を添加し、これを金属粒子表面に吸着させる。そして、容器底部に配置した気泡発生器11bから気泡を出してこの気泡を金属粒子に吸着させ、気泡の浮力によって金属粒子を浮上させて金属粒子含有物を回収すると共に、金属粒子を含まない廃材溶液も回収する。前記の界面活性剤は、廃材溶液WSが溶剤系の場合には非イオン性界面活性剤、水系の場合にはアニオン界面活性剤が適している。また、気泡を保つために脂肪酸の多価アルコールエステル等の泡安定剤を添加するのが望ましい。また、気泡を保つために脂肪酸の多価アルコールエステル等の泡安定剤を添加するのが望ましい。また、気泡を保11bの条件としては、空気を11人minの

流量で直径2~5mmの気泡を激しくパブリングできる ものが望ましい。さらに、廃材溶液WSの粘度が低いと 逆に金属粒子が沈降し易くなるため、廃材溶液WSの固 形分を40 w t %以上とすることが望ましい。

11

【0041】図8(E)に示した静置分離装置12は容 器12aを備える。金属除去に際しては、容器12a内 に入れた廃材溶液WSに酸水溶液を添加し、金属粒子の みを溶解する。金属溶解後、静置により水相と溶剤相に 相分離させ、相分離後に容器底部から溶剤相(金属含有 物)を排出して回収すると共に、金属を含まない廃材溶 10 液も回収する。金属粒子のみを溶解するための酸の種類 としては硝酸が適しているが、セラミック粒子を溶解せ ずに金属粒子のみを溶解する酸濃度を適切に調製する。

【0042】金属除去工程後は、次に、金属が除去され た廃材溶液の成分調整(成分調整工程)を行う。この成 分調整工程の内容は図1の再生処理手順で説明したもの と同様である。

【0043】以上で、金属材料を含む未焼成セラミック 廃材から再生セラミックスラリーを得ることができる。

【0044】 この再生セラミックスラリーはセラミック 20 電子部品を製造する際の材料として非再生のものと同様 に用いることができる。例えば、同時焼成タイプの積層 セラミックコンデンサを製造するときには、帯状フィル ムの上に前記の再生セラミックスラリーを塗工してグリ ーンシートを作成することができ、この後は従来と同様 に、グリーンシート上に導体ペーストを印刷して所定配 列の内部電極用導体層を形成する工程、グリーンシート を単位寸法で打ち抜きこれを積層して圧着する工程、圧 着シートをダイサーやスライサー等の装置によってチッ プサイズに分断する工程、各未焼成チップからバインダ ーを除去する工程、各未焼成チップの表面に導体ペース トを塗布して外部電極用導体層を形成する工程、各未焼 成チップを内部電極用の未焼成導体層及び外部電極用の 未焼成導体層と一緒に焼成する工程、外部電極の表面に 1以上のメッキ層を形成する工程を実施して積層セラミ ックコンデンサを製造することができる。また、非同時 焼成タイプの積層セラミックコンデンサを製造するとき には、前記脱バインダー工程の後に各未焼成チップを内 部電極用の未焼成導体層と一緒に焼成した後に、各焼成 チップの表面に導体ベーストを塗布して外部電極用導体 40 粒子を完全に捕獲するために、限界濾過膜の有効捕獲粒 層を形成してれを焼成して外部電極を形成すればよい。

【0045】また、前記の金属除去工程において金属粒 子含有物または金属含有物を回収可能な場合には、回収 した金属粒子含有物または金属含有物を前記溶解工程と 同様に選定した溶剤を用いて固形分30wt%以下の濃 度で少なくとも1回洗浄し、この後に溶剤を除去し乾燥 させて金属粒子を回収し、必要に応じて粉砕等を行うと とで再生金属粉末を得ることもできる。この再生金属粉 末は、セラミック電子部品を製造する際の材料として非

ミックコンデンサを製造するときには、導体ペースト用 の金属粉末として用いることができる。

【0046】 [図3(A) に示した再生処理手順] 金属 材料を含まない未焼成セラミック廃材から再生セラミッ ク粉末を得るときには、まず、溶剤により未焼成セラミ ック廃材の溶解(溶解工程)を行い、必要に応じて溶解 工程の前段階で未焼成セラミック廃材の粉砕(粉砕工 程)を行う。この溶解工程と粉砕工程の内容は図1の再 生処理手順で説明したものと同様である。

【0047】溶解工程後は、次に、廃材溶液からのバイ ンダー除去 (バインダー除去工程)を行う。前記の廃材 溶液には、セラミック粒子とバインダーと可塑剤と分散 剤と溶剤等が既に含まれているが、ここでは廃材溶液か ら主としてバインダーを分離して除去する。

【0048】図9(A)~図9(C)はこのバインダー 除去工程で使用可能な設備をそれぞれ示す。

【0049】図9(A)に示した沈殿装置13は容器1 3 a を備える。バインダー除去に際しては、容器13 a 内に入れた廃材溶液WSに前記溶剤を固形分濃度が30 wt%以下となるように添加して希釈し、静置によりセ ラミック粒子を沈殿させ、セラミック粒子を含まない廃 材溶液、つまり、バインダーが溶解されている廃材溶液 を排出してセラミック粒子含有物を回収する。

【0050】図9(B)に示した遠心分離装置14は回 転容器14aを備える。バインダー除去に際しては、廃 材溶液WSを回転容器14a内に入れた後、セラミック 粒子を完全に分離するために外周部周速を20m/se c以上となるように設定し、回転容器14aを少なくと も1時間以上回転させて遠心分離を行いセラミック粒子 を分離し、セラミック粒子を含まない廃材溶液、つま り、バインダーが溶解されている廃材溶液を排出してセ ラミック粒子含有物を回収する。

【0051】図9(C)に示した濾過装置15は容器1 5 a と濾過器 1 5 b とを備える。バインダー除去に際し ては、廃材溶液WSを容器15a内に入れ、廃材溶液中 のセラミック粒子を濾過器15 b内の限界濾過膜によっ て捕獲し、セラミック粒子を含まない廃材溶液、つま り、バインダーが溶解されている廃材溶液を排出してセ ラミック粒子含有物を回収する。このとき、セラミック 子径を0. 1μm以下とするのが望ましい。

【0052】バインダー除去工程後は、次に、回収され たセラミック粒子含有物の粉末化(粉末化工程)を行

【0053】図10(A)~図10(D)はこの粉末化 工程で使用可能な設備をそれぞれ示す。

【0054】図10(A)に示した加熱炉16は、回収 されたセラミック粒子含有物を加熱して乾燥させるため のものである。回収されたセラミック粒子含有物WSa 再生のものと同様に用いることができ、例えば積層セラ 50 には溶剤と微量のバインダー等が付着しているため、こ

れを溶剤及びバインダーの熱分解点以上の温度(300 ~600℃)で加熱して除去する処理を事前に行う。

13

【0055】図10(B)に示した粉砕装置17は容器 17aと撹拌機17bと粉砕ローラー17cとを備え る。粉末化に際しては、乾燥後のセラミック粒子WSb を容器17a内に投入しながら撹拌機17b及び粉砕口 ーラー17cを回転させ、セラミック粒子WSbを砕い て粉末化(符号PO参照)する。

【0056】図10(C)に示した粉砕装置18は容器 18aと昇降式の粉砕機18bとを備える。粉末化に際 10 しては、乾燥後のセラミック粒子WSbを容器18a内 に入れ、これを昇降する粉砕機18bによって砕いて粉 末化する。

【0057】図10(D) に示した粉砕装置19は容器 19aと回転式の粉砕機19bとを備える。粉末化に際 しては、乾燥後のセラミック粒子WSbを容器19a内 に入れ、これを粉砕機19bによって砕いて粉末化す

【0058】以上で、金属材料を含まない未焼成セラミ ック廃材から再生セラミック粉末を得ることができる。 【0059】との再生セラミック粉末はセラミック電子 部品を製造する際の材料として非再生のものと同様に用 いることができる。例えば、同時焼成タイプの積層セラ ミックコンデンサを製造するときには、グリーンシート 用のセラミックスラリーを前記の再生セラミック粉末を 用いて調製することができ、この後は従来と同様に、帯 状フィルムの上にセラミックスラリーを塗工してグリー ンシートを作成する工程、グリーンシート上に導体ペー ストを印刷して所定配列の内部電極用導体層を形成する 工程、グリーンシートを単位寸法で打ち抜きこれを積層 して圧着する工程、圧着シートをダイサーやスライサー 等の装置によってチップサイズに分断する工程、各未焼 成チップからバインダーを除去する工程、各未焼成チッ プの表面に導体ペーストを塗布して外部電極用導体層を 形成する工程、各未焼成チップを内部電極用の未焼成導 体層及び外部電極用の未焼成導体層と一緒に焼成する工 程、外部電極の表面に1以上のメッキ層を形成する工程 を実施して積層セラミックコンデンサを製造することが できる。また、非同時焼成タイプの積層セラミックコン デンサを製造するときには、前記脱パインダー工程の後 に各未焼成チップを内部電極用の未焼成導体層と一緒に 焼成した後に、各焼成チップの表面に導体ベーストを塗 布して外部電極用導体層を形成してれを焼成して外部電 極を形成すればよい。

【0060】また、前記のバインダー除去工程において バインダー含有物を回収可能な場合には、回収したバイ ンダー含有物を乾燥させ、必要に応じて粉砕することで 再生バインダーを得ることもできる。この再生バインダ ーは、セラミック電子部品を製造する際の材料として非 再生のものと同様に用いることができ、例えば積層セラ 50 溶解(溶解工程)を行い、必要に応じて溶解工程の前段

ミックコンデンサを製造するときには、導体ペースト用 のバインダーとして用いることができる。

【0061】 [図3(B) に示した再生処理手順] 金属 材料を含まない未焼成セラミック廃材から再生セラミッ ク粉末を得るときには、まず、未焼成セラミック廃材か らのバインダー除去 (バインダー除去工程)を行う。前 記の未焼成セラミック廃材には、セラミック粒子とバイ ンダーと可塑剤と分散剤と溶剤等が既に含まれている が、ことでは未焼成セラミック廃材から主としてバイン ダーを分離して除去する。

【0062】図面には示していないが、バインダーを除 去する方法としては、未焼成セラミック廃材をバインダ ーの熱分解点以上の温度(300~600℃)で加熱し て、含有バインダーを熱分解により除去する。この熱処 理により未焼成セラミック廃材に含まれている分散剤と 溶剤も同様に熱分解されて除去され得る。

【0063】バインダー除去工程後は、次に、バインダ ーが除去された未焼成セラミック廃材の粉末化(粉末化 工程)を行う。この粉末化工程は図3(A)の再生処理 20 手順で説明したものと同様である。

【0064】以上で、金属材料を含まない未焼成セラミ ック廃材から再生セラミック粉末を得ることができる。 【0065】この再生セラミック粉末はセラミック電子 部品を製造する際の材料として非再生のものと同様に用 いることができる。例えば、同時焼成タイプの積層セラ ミックコンデンサを製造するときには、グリーンシート 用のセラミックスラリーを前記の再生セラミック粉末を 用いて調製することができ、この後は従来と同様に、帯 状フィルムの上にセラミックスラリーを塗工してグリー ンシートを作成する工程、グリーンシート上に導体ペー ストを印刷して所定配列の内部電極用導体層を形成する **工程、グリーンシートを単位寸法で打ち抜きこれを積層** して圧着する工程、圧着シートをダイサーやスライサー 等の装置によってチップサイズに分断する工程、各未焼 成チップからバインダーを除去する工程、各未焼成チッ プの表面に導体ペーストを塗布して外部電極用導体層を 形成する工程、各未焼成チップを内部電極用の未焼成導 体層及び外部電極用の未焼成導体層と一緒に焼成する工 程、外部電極の表面に1以上のメッキ層を形成する工程 を実施して積層セラミックコンデンサを製造することが できる。また、非同時焼成タイプの積層セラミックコン デンサを製造するときには、前記脱バインダー工程の後 に各未焼成チップを内部電極用の未焼成導体層と一緒に 焼成した後に、各焼成チップの表面に導体ペーストを塗 布して外部電極用導体層を形成してれを焼成して外部電 極を形成すればよい。

【0066】 [図4に示した再生処理手順] 金属材料を 含む未焼成セラミック廃材から再生セラミック粉末を得 るときには、まず、溶剤により未焼成セラミック廃材の (9)

20

階で未焼成セラミック廃材の粉砕(粉砕工程)を行う。 この溶解工程と粉砕工程の内容は図1の再生処理手順で 説明したものと同様である。

15

【0067】溶解工程後は、次に、廃材溶液からの金属 除去(金属除去工程)を行う。この金属除去工程の内容 は図2の再生処理手順で説明したものと同様である。

【0068】金属除去工程後は、次に、廃材溶液からの バインダー除去 (バインダー除去工程) を行う。 このバ インダー除去工程の内容は図3(A)の再生処理手順で 説明したものと同様である。また、バインダーを除去す 10 る方法としては、廃材溶液を乾燥して固化させ、これを バインダーの熱分解点以上の温度(300~600℃) で加熱して、含有バインダーを熱分解により除去する方 法も利用できる。

【0069】バインダー除去工程後は、次に、回収され たセラミック粒子含有物の粉末化(粉末化工程)を行 う。この粉末化工程の内容は図3(A)の再生処理手順 で説明したものと同様である。

【0070】以上で、金属材料を含む未焼成セラミック 廃材から再生セラミック粉末を得ることができる。

【0071】この再生セラミック粉末はセラミック電子 部品を製造する際の材料として非再生のものと同様に用 いることができる。例えば、同時焼成タイプの積層セラ ミックコンデンサを製造するときには、グリーンシート 用のセラミックスラリーを前記の再生セラミック粉末を 用いて調製することができ、この後は従来と同様に、帯 状フィルムの上にセラミックスラリーを塗工してグリー ンシートを作成する工程、グリーンシート上に導体ペー ストを印刷して所定配列の内部電極用導体層を形成する 工程、グリーンシートを単位寸法で打ち抜きこれを積層 30 して圧着する工程、圧着シートをダイサーやスライサー 等の装置によってチップサイズに分断する工程、各未焼 成チップからバインダーを除去する工程、各未焼成チッ プの表面に導体ペーストを塗布して外部電極用導体層を 形成する工程、各未焼成チップを内部電極用の未焼成導 体層及び外部電極用の未焼成導体層と一緒に焼成する工 程、外部電極の表面に1以上のメッキ層を形成する工程 を実施して積層セラミックコンデンサを製造することが できる。また、非同時焼成タイプの積層セラミックコン デンサを製造するときには、前記脱バインダー工程の後 40 に各未焼成チップを内部電極用の未焼成導体層と一緒に 焼成した後に、各焼成チップの表面に導体ベーストを塗 布して外部電極用導体層を形成してれを焼成して外部電 極を形成すればよい。

【0072】また、前記の金属除去工程において金属粒 子含有物または金属含有物を回収可能な場合には、回収 した金属粒子含有物または金属含有物を前記溶解工程と 同様に選定した溶剤を用いて固形分30wt%以下の濃 度で少なくとも1回洗浄し、この後に溶剤を除去し乾燥 させて金属粒子を回収し、必要に応じて粉砕等を行うと 50 再生セラミックスラリーを生成する処理手順を示す図

とで再生金属粉末を得ることもできる。この再生金属粉 末は、セラミック電子部品を製造する際の材料として非 再生のものと同様に用いることができ、例えば積層セラ ミックコンデンサを製造するときには、導体ペースト用 の金属粉末として用いることができる。

【0073】さらに、前記のバインダー除去工程におい てバインダー含有物を回収可能な場合には、回収したバ インダー含有物を乾燥させ、必要に応じて粉砕すること で再生バインダーを得ることもできる。この再生バイン ダーは、セラミック電子部品を製造する際の材料として 非再生のものと同様に用いることができ、例えば積層セ ラミックコンデンサを製造するときには、導体ペースト 用のバインダーとして用いることができる。

【0074】とのように、積層セラミックコンデンサの 製造過程で生じた未焼成セラミック廃材を再生して再生 セラミックスラリーや再生セラミック粉末を生成すると とができ、これらを積層セラミックコンデンサを製造す る際の材料として非再生のものと同様に用いることがで きる。これにより、廃材処分に要するコスト負担を軽減 できると共にセラミック電子部品の製造コストの低減等 を図ることができる。

【0075】また、廃材溶液中に含まれる金属粒子やバ インダーを適宜分離して回収し、これらを再生金属粉末 や再生バインダーとして利用することも可能であるの で、未焼成セラミック廃材をより効果的に再生利用し て、前記の廃材処分に要するコスト負担の軽減やセラミ ック電子部品の製造コストの低減等に貢献できる。

【0076】尚、前述の説明では、積層セラミックコン デンサの製造過程で生じた未焼成セラミック廃材を再生 利用する場合を例に挙げたが、積層セラミックコンデン サに限らず、積層セラミックコンデンサと同じ工程或い は近似の工程を利用して製造される他種のセラミック電 子部品、例えば積層セラミックコンデンサアレイや積層 セラミックインダクタや積層セラミックLCフィルター 等の製造過程で発生する未焼成セラミック廃材を前記と 同様の処理手順にて再生して再生セラミックスラリーや 再生セラミック粉末、さらには再生金属粉末や再生バイ ンダー等を得ることができ、また、これらをセラミック 電子部品を製造する際の材料として非再生のものと同様 に用いることができる。

## [0077]

【発明の効果】以上詳述したように、本発明によれば、 廃材処分に要するコスト負担の軽減及びセラミック電子 部品の製造コストの低減等に貢献できる、再生セラミッ クスラリー及びその製造方法と、再生セラミック粉末及 びその製造方法と、セラミック電子部品及びその製造方 法を提供することができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】金属材料を含まない未焼成セラミック廃材から

\*

10

【図2】金属材料を含む未焼成セラミック廃材から再生 セラミックスラリーを生成する処理手順を示す図

【図3】金属材料を含まない未焼成セラミック廃材から 再生セラミック粉末を生成する処理手順を示す図

【図4】金属材料を含む未焼成セラミック廃材から再生

セラミック粉末を生成する処理手順を示す図

【図5】溶解工程で使用可能な設備を示す図

【図6】粉砕工程で使用可能な設備を示す図

\*【図7】成分調整工程で使用可能な設備を示す図 【図8】金属除去工程で使用可能な設備を示す図

【図9】バインダー除去工程で使用可能な設備を示す図

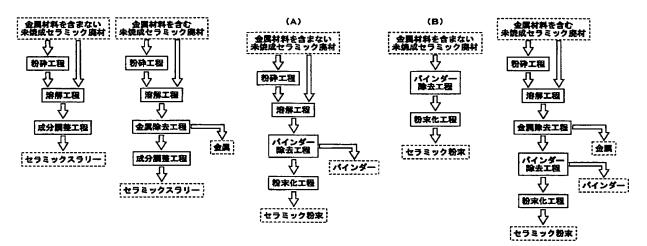
【図10】粉末化工程で使用可能な設備を示す図 【符号の説明】

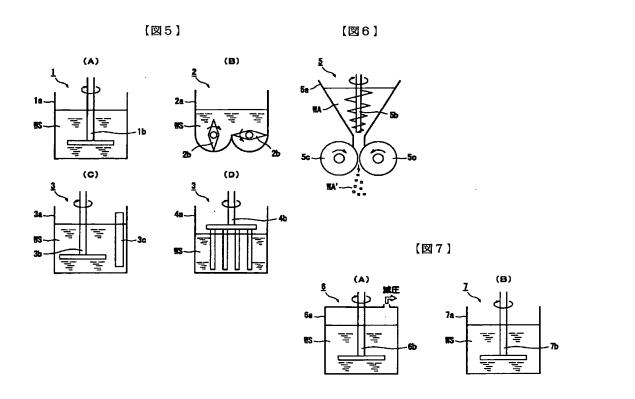
WA…未焼成セラミック廃材、WS…廃材溶液、PO… セラミック粉末。

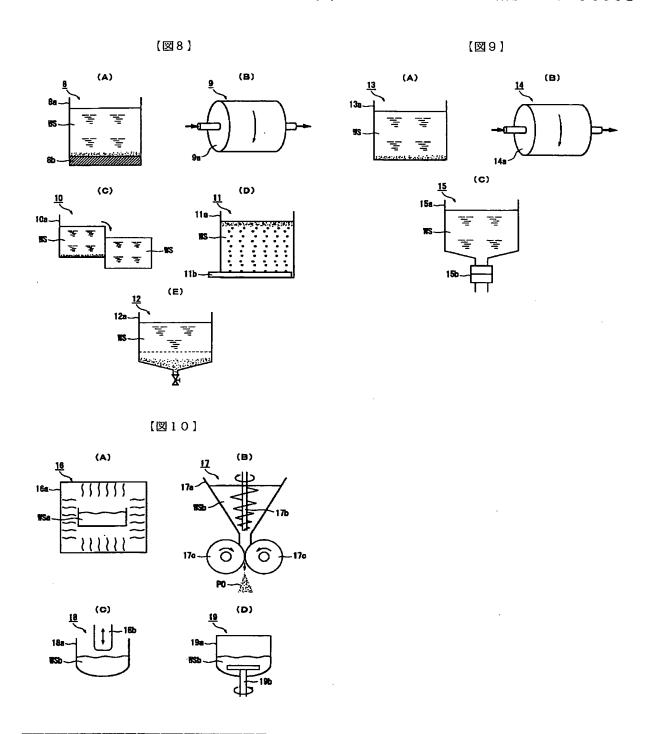
【図1】 【図2】

【図3】

【図4】







フロントページの続き

(51)Int.Cl.'
C 0 4 B 35/626

識別記号

F I B O 9 B 3/00 テーマコード(参考)

ZAB

(72)発明者 松下 邦博

東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘

電株式会社内

(72)発明者 都城 誠

東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘

電株式会社内

(72)発明者 菊地 均

東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘

電株式会社内

(72)発明者 糸井 肇

東京都台東区上野6丁目16番20号 太陽誘

電株式会社内

Fターム(参考) 4D004 AA19 AB03 AB05 BA05 CA04

CA10 CA13 CA41 CB13 CB27

CC04

4G030 BA09 CA08 GA01 GA09 GA18